InPナノ粒子の合成と評価

(東大院工) 〇松本太一、前之園信也、山口由岐夫

【Abstract】コロイド化学的な方法によるInPナノ粒子の合成について報告する。トリ スジメチルアミノホスフィン[P(NMe₂)₃]と塩化インジウム(InCl₃)を原料とし、表面修飾 剤としてTOPO/TOPを用いた。合成は、345℃に昇温したTOPO/TOP混合物に原料を 注入した後、300℃で1時間保持することによって行った。その結果、可視光領域で蛍 光発光する褐色のInPナノ粒子粉末を得た。得られたInPナノ粒子の評価にはTEM、電 子線回折、X線回折(XRD)、蛍光X線分析、UV-vis、蛍光光度計、蛍光寿命測定を用い た。

【Introduction】半導体ナノ粒子(NC)は、量子閉じ込め効果によってバルクには観察さ れない物性を示すため、新規光機能材料として近年注目されている。その中で、III-V 族NCは、その優れた電気伝導特性を活かし、microwave deviceやoptoelectronicsへの 応用が期待されている。しかしながら、CdSeのようなII-VI族NCに比べ、合成が難し いため、物性の理解があまり進んでいないのが現状である。III-V族NCの一つであるInP NCの合成法はいくつか報告されている。例えば、化学気相成長法[1]、single-molecular precursorsの熱分解[2]、sodium phosphideを用いたdirect reaction[3]などである。そ の中でも、もっとも確立されている液相合成法は表面修飾剤にトリオクチルホスフィン (TOP)とトリオクチルホスフィンオキシド(TOPO)を用いたコロイド化学法である [4,5]。しかし、上記方法で用いられているPの原料は安定性、燃焼性などの点で取り扱 いが非常に厳しい。そこで今回、我々は初めてPの原料としてP(NMe2)3を用いたコロイ ド化学的合成法を提案する。P(NMe2)3は上記Pの原料に比べ、安定であり、燃焼性も少 なく、安全性の面で優れている。

【Experimental】InCl₃ (0.8g) 、P(NMe₂)₃ (0.5g) と表面修飾剤[5g; TOPO/TOPの混 合物を体積比にして(a) 0.15:1、(b) 1:1]をグローブボックス中にて混合し前駆体となる 溶液を作った。三口フラスコ内にて5gのTOPO/TOP [(a)TOPO:TOP= 0.15:1、(b) 1:1] を100℃に昇温し、真空に20分間引いた後、Arで3回パージを行い、三口フラスコ内の 酸素などの不純物を除いた。Ar雰囲気下で三口フラスコを345℃まで昇温し、上記前駆 体溶液を急速に注入した。注入後、温度を300℃で1時間保った。その後、1-ブタノール と脱水メタノールを用いて粒子を遠沈させることで、褐色の固体粉末を得た。得られた 生成物は真空中に保存した。

【Result and discussion】生成した粉末(a)のXRDパターンをFig. 1 に示す。XRDパタ ーンのそれぞれのピークはInP結晶の 111、220、311 面のピークと一致しており、そ れぞれ20は26.2°、46.3°、51.7°であった。111 ピー クを用いて、Scherrer式から算出した粒径は約 3.3nmであった。

(a)の条件下で合成したInP NCのTEM像を
Fig. 2 に示す。粒径が約2~4nmの粒子が観察され、
電子線回折からもInP NCであることが確認できた。

また(a)の条件下で合成したInP NCのヘキサン分 散液の吸収スペクトルをFig. 3に示す。また、Fig. 4 に条件(a)及び(b)のもとで合成したInP NCの蛍光ス ペクトルを示す。TOPOとTOPの比により蛍光波長 が制御できることがわかる。表面修飾剤としてInP ナノ粒子にTOPOとTOPが配位しているが、TOPO のほうがTOPに比べ配位力が強く、そのため、 TOPOが多いほど核成長が抑えられ粒径が小さくな り、蛍光波長のピークが短波長側に移動したと考え られる。また、長波長側にブロードな肩を持ってい るが、これはP欠陥から生じるtrap準位からの再結 合によるものであると考えられる[5]。

【Conclusion】トリスジメチルアミノホスフィン [P(NMe2)3]をPの原料として用い、可視光領域で蛍 光発光するInPナノ粒子を合成した。TOPOとTOP の比により蛍光波長を制御することができた。

[Reference] [1] M.S. Skolnick, L.L. Taylor, S.J. Bass, D.A. Pitt, M.J. Mowbray, A.J. Cullis, Appl. Phys. Lett. 53 (1998) 24. [2]M. Green, P. O'Brien, Chem. Commun. (1998) 2459. [3]P.K. Khanna, M.-S. Eum, Ki-Won Jun, Jin-Ook Baeg, Sang Seok, Mater. Lett. 57 (2003) 4617 [4]O.I. Micic, C.J. Curtis, K.M. Jones, J.R. Sprague, A.J. Nozik, J. Phys. Chem. 98 (1994) 4966 [5]L. Langof, L. Fradkin, E. Ehrenfreund, E. Lifshitz, O.I. Micic, A.J. Nozik, Chem. Phys. 297 (2004) 93



Fig.1 XRD pattern



Fig.2 TEM micrograph



